одновременно дрейфуют через узкозонную  $p^+$ область 5 к ее поверхности й проходят в активированный слой 6 с низкой работой выхода, с поверхности которого электроны эффективно излучаются. В случае отсутствия активированного слоя 6 электроны могут эффективно излучаться в вакууме и внешней поверхностью  $p^+$ области 5.

С ростом питающего напряжения при условии минимальных потерь электронов в p- и  $p^+$ -областях поток излучаемых электронов практически экспоненциально возрастает с ростом Uq. Поскольку p-n-гомопереход смещен в прямом направлении, его напряжение невелико и изменяется в пределах 0,9–2,5 В, при этом поток излучаемых электронов возрастает на несколько порядков.

Экспериментальное устройство – твердотельный источник электронной эмиссии размером  $3\times3$  мм полупроводниковой структурой *nSi-pSi*-p+InSb. При этом толщина слоя nSi составляет (0,8–1) мкм слоя pSi – (0,15–0,2) мкм и слоя p+InAs – (0,2–0,3) мкм. Активированным слоем является слой цезия толщиной (3–7)  $10^{-3}$  мкм.

Экспериментальный катод обеспечивает эмиссию электронов плотностью 20–50 мА/мм<sup>2</sup> при питающем напряжении 1,2–1,8 В и комнатной температуре. Нестабильность эмиттируемого катодом электронного потока не превышает 30 %. Технико-экономические преимущества предлагаемого электронного многослойного катода в сравнении с аналогами следующие:

 – более чем на порядок возрастает срок службы (с 103 до 104–105 у часов);

 повышается максимальная плотность тока эмиссии в 10 и более раз;

– более чем на порядок снижается нестабильность работы твердотельный источник электронной эмиссии с (5–8) раз у прототипа, до 0,3 у предлагаемого устройства.

Многослойный полупроводниковый катод, содержащий подложку из полупроводника *n*-типа с омическим контактом к ней, слой *p*-типа с омическим контактом; расположенный, на подножке *n*типа, слой активатора на поверхности слоя *p*-типа, свободной от омического контакта, причем области *p*-*n*-перехода покрыты слоем диэлектрика, отличающийся тем, что, с целью повышения срока службы л плотности тока эмиссии, между слоем *p*-типа и слоем активатора расположен *p*<sup>+</sup>-слой узкозонного по отношению к слою *p*-типа полупроводника.

## Литература

1. Губкин, А. Н. Электреты. М.: Наука, 1998. – 164 с. 2. Электретные источники электроэнергии / В. А. Сычик [и др.] // Материалы МНТК «Демографические проблемы Беларуси», ч. 3. Мн., 1999. – С. 54.

### УДК 621.793.18

# ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИОННО-ЛУЧЕВЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МИШЕНЕЙ Телеш Е. В.<sup>1</sup>, Сафронов Н. В.<sup>2</sup>, Шевчик Е. В.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники <sup>2</sup>ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Исследовано влияние материала мишени на основные оптические характеристики свойства фторуглеродных покрытий, полученных ионно-лучевым распылением. Установлено, что покрытия, полученные распылением мишени из политетрафторэтилена, обладали более высокой прозрачностью, шириной запрещенной зоны и низким коэффициентом преломления.

Ключевые слова: фторуглеродные покрытия, оптические характеристики, ширина запрещенной зоны, ионно-лучевое распыление.

# OPTICAL CHARACTERISTICS OF FLUOROCARBON COATINGS OBTAINED BY ION BEAM SPUTTERING OF VARIOUS TARGETS Telesh E.<sup>1</sup>, Safronov N.<sup>2</sup>, Shevchik E.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics <sup>2</sup>OJSC Minsk Research Institute of Radiomaterials Minsk, Republic of Belarus

**Abstract.** The influence of the target material on the main optical characteristics of the properties of fluorocarbon coatings obtained by ion-beam sputtering has been studied. It was found that coatings obtained by sputtering a polytetrafluoroethylene target had higher transparency, a wider band gap, and a low refractive index. **Key words:** fluorocarbon coatings, optical characteristics, band gap, ion-beam sputtering.

Адрес для переписки: Телеш Е. В., ул. П. Бровки, 6, г. Минск 220113, Республика Беларусь e-mail: etelesh@bsuir.by

Одним из наиболее перспективных материалов, обладающим уникальным комплексом физико-химических свойств, являются соединения фтора с углеродом. При использовании фторуглеродных покрытий в качестве оптических и защитных покрытий для оптических приборов важным параметром является их способность преломлять и пропускать поток света, обладать минимальной пористостью.

Для получения покрытий можно применить распыление мишени из политетрафторэтилена (ПТФЭ), составной мишени из ПТФЭ и графита, а также графитовой мишени [1–3].

Задачей данных исследований было исследование влияния материала распыляемой мишени на оптические характеристики фторуглеродных покрытий. Схема ионно-лучевого распыления (ИЛР) мишеней различного состава представлена на рисунке 1. Для компенсации положительного заряда на составной мишени 2 и мишени из ПТФЭ и применялся термокатод 3 из вольфрама. Ионный источник 1 представлял собой ускоритель с анодным слоем. В качестве подложки 4 использовалось оптическое стекло К8, в качестве рабочих газов – аргон, метан и хдадон-218 ( $C_3F_8$ ).



Рисунок 1 – Схема ионно-лучевого распыления мишеней различного состава

_					
	Газовая	Парциаль-	Рабочее	$U_{\mathrm{a}},$	Τ,
	среда	ное	давление,	кВ	%
		давление	Па		
		хладона,			
		СН4, Па			
I	Аr+пары	-	2,3.10-1	1,3	91,0
	CF <sub>4</sub>				
Г	Іары CF4	-	$2,4 \cdot 10^{-1}$	2,5	92,5
Α	r+хладон	$2,0.10^{-2}$	$2,4 \cdot 10^{-1}$	1,0	93,0
Α	r+хладон	$4,0.10^{-2}$	$2,4 \cdot 10^{-1}$	1,2	93,5
	Ar+CH <sub>4</sub>	$1,8.10^{-2}$	$1,7 \cdot 10^{-1}$	2,0	91,7
	Ar+CH <sub>4</sub>	3,0.10-2	$1,6.10^{-1}$	1,9	92,7
	Ar+CH <sub>4</sub>	5,3.10-2	$1,4.10^{-1}$	2,0	92,0
		- /	/ -	, -	- ,-

Таблица 1 – Исследования влияния газовой среды на пропускание покрытий

Измерение оптического пропускания покрытий осуществлялось в диапазоне 350–900 нм с помощью спектрофотометра PROSCAN.

В таблице 1 приведены результаты по влиянию состава газовой среды на пропускание Т покрытий, полученных ИЛР мишени из ПТФЭ, на длине волны  $\lambda = 555$  нм. Установлено, что при распылении в парах политетрафторэтилена наблюдается улучшение параметров покрытий. Добавка к рабочему газу хладона-218 также привела к росту пропускания до 93,5 %. Также было установлено, что при величине пар

циального давления метана  $CH_4$  от  $1,8\cdot10^{-2}$  до  $5,3\cdot10^{-2}$  Па оптические характеристики практически не изменились.

Нагрев подложки до 450 К позволил повысить пропускание до 96,5 % (рисунок 2)



Рисунок 2 – Зависимость пропускания от температуры подложки

На рисунке 3 представлена зависимость пропускания фторуглеродных покрытий, полученных распылением составной мишени, от парциального давления хладона. Максимальное пропускание составило 96 %.

Покрытия, сформированные реактивным ИЛР мишени из графита в среде хладона, обладали максимальным пропусканием 85 % и имели светло-коричневую окраску.

Ширина запрещенной зоны рассчитывалась путем анализа спектров пропускания. Для покрытий, полученных распылением мишени из политетрафторэтилена, она составила 3,32–3,38 эВ, для составной мишени – 3,10–3,25 эВ, для мишени из графита – 2,9–3,0 эВ и практически не зависела от режимов формирования покрытий.



Рисунок 2 – Зависимость пропускания от парциального давления хладона

Измерение коэффициента преломления n с применением эллипсометра ЛЭФ-3 показало, что покрытия, полученные ИЛР мишени из ПТФЭ, обладали значениями n = 1,35-1,63, которые зависели от состава газовой среды, в частности n увеличивался с ростом давления метана. Для покрытий, полученных распылением составной мишени, n составил 1,6–2,1 и увеличивался с ростом температуры подложки. Коэффициент преломления составил 1,40–1,68 для покрытий, сформированных реактивным ИЛР мишени из графита. Увеличение парциального давления хладона, наличие положительного потенциала на мишени способствовало снижению n, а повышение температуры подложки – росту *n*.

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные оптические характеристики фторуглеродных покрытий, полученных ионно-лучевым распылением мишеней с разным составом.

### Литература

1. Телеш, Е. В. Ионно-лучевое распыление мишени из политетрафторэтилена / Е. В. Телеш, В. А. Точеный// Приборостроение – 2021: материалы 14-й Междун. научно-технической конференции (Минск, 18–20 но-

ября 2021 г.) / Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск, 2021 – С. 355–356.

 Шевчик, Е.В. Формирование фторуглеродных покрытий ионно-лучевым распылением составной мишени/ Е. В. Шевчик, А. Н. Потылкин, Е. В. Телеш // Электронные системы и технологии: сборник материалов 59-ой научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов учреждения образования БГУИР. – С. 539–541.

3. Телеш, Е. В. Формирование фторуглеродных покрытий реактивным ионно-лучевым распылением мишени из графита / Е. В. Телеш, А. Н. Потылкин // Актуальные проблемы физики, электроники и энергетики [Электронный ресурс]: электронный сборник статей I международной научно-практической конференции, Новополоцк, 27–28 окт. 2022 г. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. – Новополоцк, 2023. – С. 157–161.

#### УДК 621.793.18

## ВЛИЯНИЕ СОСТАВА РАБОЧЕГО ГАЗА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЯМЫМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ИОННЫХ ПУЧКОВ Телеш Е. В., Шевчик Е. В., Курбако Е. Г., Перепечко Е. Ю.

## Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Исследовано влияние парциального давления хладона-218 на свойства фторуглеродных покрытий, полученных прямым осаждением из ионных пучков. В результате проведенных исследований определен оптимальный диапазон давления хладона-218 (7,98·10<sup>-2</sup>–1,06·10<sup>-1</sup>) для формирования покрытий с оптической прозрачностью до 83 %, углом смачивания до 75 градусов и шириной запрещенной зоны около 2,8 эВ.

**Ключевые слова:** фторуглеродные покрытия, прямое осаждение, электрофизические характеристики, ширина запрещенной зоны, оптическое пропускание, угол смачивания.

# INFLUENCE OF WORKING GAS COMPOSITION ON THE CHARACTERISTICS OF FLUOROCARBON COATINGS OBTAINED BY DIRECT DEPOSITION FROM ION BEAMS

# Telesh E., Shevchik E., Kurbako E., Perepechko E.

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Minsk, Republic of Belarus

**Abstract.** The influence of the partial pressure of freon-218 on the properties of fluorocarbon coatings obtained by direct deposition from ion beams has been studied. As a result of the research, the optimal pressure range of freon-218 ( $7,98\cdot10^{-2}-1,06\cdot10^{-1}$ ) was determined for the formation of coatings with optical transparency of up to 83 %, a contact angle of up to 75 degrees and a band gap of about 2,8 eV.

**Key words:** fluorocarbon coatings, direct deposition, electrophysical characteristics, band gap, optical transmission, contact angle.

Адрес для переписки: Телеш Е. В., ул. П. Бровки, 6, г. Минск 220113, Республика Беларусь e-mail: etelesh@bsuir.by

Тонкопленочные фторуглеродные слои применяются в приборостроении в качестве low-k диэлектриков, оптических, гидрофобных, защитных покрытий [1]. Для синтеза фторуглеродных покрытий обычно используются плазменные разряды в углерод- и фторсодержащих газах с применением методов ВЧ плазмохимического осаждения, индуктивно-связанной плазмы, импульсной плазмы высокой плотности [2]. На характеристики покрытий определяющее влияние оказывают состав рабочего газа, мощность плазменного разряда, величина отрицательного смещения на подложке, температура подложки и т. п. Методы, основанные на нанесении тонкопленочных покрытий из ионных пучков, позволяют изменять свойства пленок посредством регулирования энергии ионов, плотности ионного потока и его состава [3]. В данной работе будет исследовано влияние парциального давления хладона-218 (C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>) в рабочем газе на характеристики фторуглеродных покрытий.

Формирование фторуглеродных покрытий проводили на модернизированной установке вакуумного напыления ВУ-1А, оснащенной ионным источником на основе торцевого холловского ускорителя (ТХУ) (рисунок 1).